五十　高性能爆薬又はその混合物であって、次のいずれかの物質を含むもの
イ　シクロテトラメチレンテトラニトラミン（別名オクタヒドロ―一・三・五・七―テトラニトロ―一・三・五・七―テトラジン、一・三・五・七―テトラニトロ―一・三・五・七―テトラアザシクロオクタン、オクトゲン又はＨＭＸ）又はその混合物
ロ　シクロトリメチレントリニトラミン（別名シクロナイト、Ｔ四、ヘキサヒドロ―一・三・五―トリニトロ―一・三・五トリアジン、一・三・五―トリニトロ―一・三・五―トリアザシクロヘキサン、ヘキソゲン又はＲＤＸ）又はその混合物
ハ　トリアミノトリニトロベンゼン又はその混合物
ニ　ヘキサニトロスチルベン又はその混合物
ホ　爆轟速度が毎秒八、〇〇〇メートルを超える物質であって、結晶密度が一立方センチメートルあたり一・八グラムを超えるもの
五十一　光電子増倍管であって、光電陰極の面積が二〇平方センチメートルを超えるもののうち、陽極パルス立上がり時間が一ナノ秒未満のもの
五十二　トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの
五十三　放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーターであって、厚さ〇・六メートル以上の放射線を遮へいする壁を隔てて操作することができるもの
五十四　放射線を遮へいするように設計した窓であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその窓枠
イ　コールドエリア側に露出する面の面積が〇・〇九平方メートルを超えるもの
ロ　密度が一立方センチメートル当たり三グラムを超える材料を用いたもの
ハ　厚さが一〇〇ミリメートル以上のもの
五十五　放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズであって、全吸収線量がシリコン換算で五〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるもの
五十六　トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物であって、トリチウムの原子数の水素の原子数に対する比率が一、〇〇〇分の一を超えるもの（装置に内蔵されたものであって、一装置当たりの放射能の総量が一、四八〇ギガベクレル未満のものを除く。）
五十七　トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ　トリチウムの製造用（濃縮用を含む。）、回収用又は貯蔵用に設計した装置
ロ　トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの（イに該当するものを除く。）
（一）水素又はヘリウムを零下二五〇度以下の温度に冷却することができる冷凍装置であって、冷凍能力が一五〇ワットを超えるもの
（二）水素の同位元素の貯蔵用の装置であって、金属水素化物を貯蔵のための媒体として用いるもの
五十八　重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒であって、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために設計したもの
五十九　ヘリウム三の混合率が天然の混合率を超えるヘリウム（容器又は装置に密封されたヘリウム三であって、その重量が一グラム未満のものを除く。）

第三条　検査法施行令別表の二の項（一）の外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一　軍用の化学製剤（次のイからヌまでのいずれかに該当するもの（ルに該当するものを除く。））
イ　Ｏ―アルキル＝アルキルホスホノフルオリダート（Ｏ―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、Ｏ―アルキルのアルキル基の炭素数が一〇以下であり、かつ、アルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。）（以下に掲げるものを含む。）
（一）Ｏ―イソプロピル＝メチルホスホノフルオリダート（別名サリン）
（二）Ｏ―ピナコリル＝メチルホスホノフルオリダート（別名ソマン）
ロ　Ｏ―アルキル＝Ｎ・Ｎ―ジアルキル＝ホスホルアミドシアニダート（Ｏ―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、Ｏ―アルキルのアルキル基の炭素数が一〇以下であり、かつ、Ｎ・Ｎ―ジアルキルのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。）（Ｏ―エチル＝Ｎ・Ｎ―ジメチルホスホルアミドシアニダート（別名タブン）を含む。）
ハ　Ｏ―アルキル＝Ｓ―二―ジアルキルアミノエチル＝アルキルホスホノチオラート（Ｏ―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、Ｏ―アルキルのアルキル基の炭素数が一〇以下であり、かつ、Ｓ―二―ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。）並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類（Ｏ―エチル＝Ｓ―二―ジイソプロピルアミノエチル＝メチルホスホノチオラート（別名ＶＸ）を含む。）
ニ　Ｓ―二―ジアルキルアミノエチル＝ヒドロゲン＝アルキルホスホノチオラート（Ｓ―二―ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。）並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
ホ　硫黄マスタード類（以下に掲げるものを含む。）
（一）二―クロロエチルクロロメチルスルフィド
（二）ビス（二―クロロエチル）スルフィド（別名マスタードガス）
（三）ビス（二―クロロエチルチオ）メタン
（四）一・二―ビス（二―クロロエチルチオ）エタン（別名セスキマスタード）
（五）一・三―ビス（二―クロロエチルチオ）―ｎ―プロパン
（六）一・四―ビス（二―クロロエチルチオ）―ｎ―ブタン
（七）一・五―ビス（二―クロロエチルチオ）―ｎ―ペンタン
（八）ビス（二―クロロエチルチオメチル）エーテル
（九）ビス（二―クロロエチルチオエチル）エーテル（別名Ｏ―マスタード）
ヘ　ルイサイト類（以下に掲げるものを含む。）
（一）二―クロロビニルジクロロアルシン（別名ルイサイト一）
（二）ビス（二―クロロビニル）クロロアルシン（別名ルイサイト二）
（三）トリス（二―クロロビニル）アルシン（別名ルイサイト三）
ト　窒素マスタード類（以下に掲げるものを含む。）
（一）ビス（二―クロロエチル）エチルアミン（別名ＨＮ一）
（二）ビス（二―クロロエチル）メチルアミン（別名ＨＮ二）
（三）トリス（二―クロロエチル）アミン（別名ＨＮ三）
チ　枯葉剤（以下に掲げるものを含む。）
（一）二―クロロ―四―フルオロフェノキシ酢酸（別名ＬＮＦ）
（二）二・四―ジクロロフェノキシ酢酸と混合された二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸
リ　サキシトキシン
ヌ　リシン
ル　次のいずれかに該当するもの
（一）塩素
（二）ジホスゲン
（三）臭化キシレン（オルソ、メタ、パラ）
（四）臭化ベンジル
（五）ヨウ化ベンジル
（六）臭化アセトン
（七）臭化シアン
（八）臭化メチルエチルケトン
（九）塩化アセトン
（十）エチルヨウ化アセテート
（十一）ヨウ化アセトン